

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2000年11月30日 (30.11.2000)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 00/71497 A1(51) 国際特許分類: C07C 23/08, H01L
21/205, 21/302, C23C 16/50

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/03308

(22) 国際出願日: 2000年5月24日 (24.05.2000)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願平11/143562 1999年5月24日 (24.05.1999) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本ゼ
オン株式会社 (NIPPON ZEON CO., LTD.) [JP/JP]; 〒
100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 Tokyo
(JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平山俊達 (HI-
RAYAMA, Toshinobu) [JP/JP]; 山田俊郎 (YAMADA,Toshiro) [JP/JP]; 杉本達也 (SUGIMOTO, Tatsuya)
[JP/JP]; 菅原 亮 (SUGAWARA, Mitsuru) [JP/JP]; 〒
210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1号
日本ゼオン株式会社 総合開発センター内 Kanagawa
(JP).(74) 代理人: 内田幸男 (UCHIDA, Yukio); 〒105-0014 東京
都港区芝二丁目5番10号 サニーポート芝1005 内田特
許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).添付公開書類:
— 国際調査報告書2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: GAS FOR PLASMA REACTION AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: プラズマ反応用ガスおよびその製造方法

(57) Abstract: A gas for plasma reaction comprising octafluorocyclopentene, characterized in that the gas has a content of octafluorocyclopentene of 99.9 vol % or more, and the total amount of nitrogen and oxygen which are contained as residual trace gas components is 200 ppm or less. This high purity gas for plasma reaction can be produced by (1) a method comprising subjecting a crude octafluorocyclopentene to a rectification in an atmosphere of an inert gas belonging to Group 0, or (2) a method comprising rectifying a crude octafluorocyclopentene to a purity of 99.9 vol % or more, and subsequently removing residual impurities.

(57) 要約:

ガスの全量に対して、オクタフルオロシクロペンテンの純度が99.9容量%以上であり、かつ残余の微量ガス成分として含まれる窒素と酸素の合計量が200容量ppm以下の高純度なプラズマ反応用ガス。この高純度プラズマ反応用ガスは、(1)オクタフルオロシクロペンテンを0属の不活性ガス中で精留する方法、または、(2)粗オクタフルオロシクロペンテンを純度99.9容量%以上に精留し、次いで残留不純物を除去する方法により製造できる。

WO 00/71497 A1